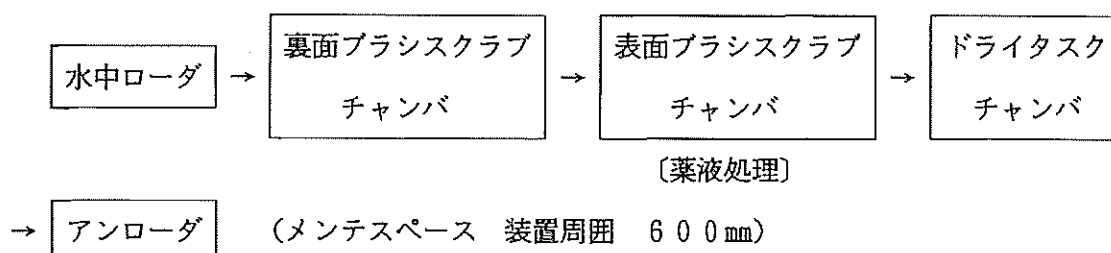


SP-W813-AS (53530-4046)

本装置は、純水及びブラシによってCMP後のウエハ表面（親水性）、裏面に付着した研磨剤を除去、更に薬液処理により金属汚染を除去するものです。

1. 装置構成



2. セットアップ  $\phi 6''$  ( $675\mu\text{m}$ ), オプション  $\phi 8''$
3. キャリヤ規格
 

$\phi 6''$	ローダ側	A182-60MJ (逆向きにセットします) (テフロン製)	
	アンローダ側	P150NK-AS (ポリプロピレン製)	専用キャリヤ
$\phi 8''$	ローダ側	A192-80M (逆向きにセットします) (テフロン製)	
	アンローダ側	PA192-80M (正向きにセットします) (ポリプロピレン製)	

(カセットガイドはアンローダ側のみ  $\phi 6''$ 、 $\phi 8''$  兼用。  
ローダ側は、 $\phi 6''$ 、 $\phi 8''$  それぞれのカセットにて対応)
4. 薬液供給ユニット 1台
5. 薬液キャビネット 低温用 1台 (温調は行いません)
6. タワーランプ (3灯立て2本)
  - ・アンローダ上部 (DS取付け)
  - ・クリーンルーム側パーテーション
7. 装置前面非常停止スイッチの他に非常停止スイッチ用配線を用意します。
8. アンローダ部にカバー取り付け ・装置前面側に扉を設けます。
9. ダウントランスを取付けます。 ( $1\phi 200\text{V} \rightarrow 1\phi 100\text{V}$ )
10. 漏水検知器を取付けます。(検知帯は各ユニットに取付けます。)
11. スペアパーツを付属します。
12. メカニカル搬送部アタッチメントに、テフロンテープを貼り付けます。

以上